

An aerial photograph of a modern, multi-story office building with a glass facade. The building is surrounded by a parking lot filled with cars. In the background, there are dense green hills under a clear sky. The text "S&S TECH (주)에스앤에스텍" is visible on the building's facade.

Investors Relations

Y2026



Disclaimer.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 관계된 사항으로 회사에 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미합니다.

자료의 "예측정보"는 향후 경영 환경의 변화 등에 따라 변화되며, 불확실성을 내포하고 있는바, 실제 미래 실적과는 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자/잠재투자자의 편의를 위해 작성된 자료이며, 공시된 내용과의 차이가 있을 경우 공시 내용을 우선으로 참고해 주시기 바랍니다.

본 자료의 활용을 인해 발생하는 손실에 대하여는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

CONTENTS

01

회사 소개

- 1-1. 회사 소개
- 1-2. 회사 연혁

02

사업 소개

- 2-1. Product Application
- 2-2. Key Figures

03

재무 현황

- 3-1. 재무 현황
- 3-2. 주요 투자 포인트

04

EUUV Business

- 4-1. EUV Blankmask 소개
- 4-2. EUV Pellicle 소개

회사명	에스앤에스텍, S&S Tech Corporation
대표이사	정수홍
설립일	2001년 2월 22일
임직원수	335명 (2026년 1월 기준)
주요 제품	반도체, 디스플레이용 블랭크 마스크
상장	코스닥 (101490)
본사주소	대구광역시 달서구 호산동로 42
특허보유	특허등록 총236건 (국내 110건/해외 126건)



EUV Center

- Location : Yongin City
- Establish : 2025.10.15
- Land : 8,250 [m²]
- C/R : 3,630 [m²]
- Product : [EUV product](#)



대구 사업장

- Location : Daegu City
- Land : 13,200 [m²]
- C/R : 5,450 [m²]
- Product : Optical Mask Blank & [EUV product](#)

2001 ~ 2009

1. Market Entry

- 회사 설립
- 국내 최초 반도체, 디스플레이용 블랭크 마스크 개발 및 양산
- 2005년 제6회 중소기업 기술혁신대전 대통령상
- 2006 대한민국 10대 신기술 지정
- 2000만불 수출탑

2009 ~ 2016

2. Growth Period

- High-End 시장 진입
- 2009 코스닥 상장
- 2014 월드 클래스 300
- 2016 대구 제2공장 준공

2017 ~ 2025

3. Expansion Period

- 2017 EUV Pellicle 개발 시작
- 첨단기술기업 지정
- 2020 EUV Blankmask 개발 시작
- 2025 용인 EUV Center 준공 (양산 준비)
- 7000만불 수출탑

2025 ~

4. Upcoming Items

- EUV Pellicle Business
- EUV Mask Blank full development & Business

국산화 최초 성공한 Blankmask

- 블랭크 마스크는 반도체 (메모리& 비 메모리) 및 디스플레이 (TFT-LCD, OLED, LED) 제조 공정에 필수적인 포토 마스크의 **핵심 원재료** 입니다.

Semiconductor Mask Blank

Mask Blank



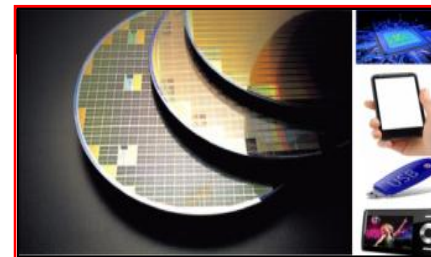
Photo Mask



Process



Semiconductor



Display Mask Blank

Mask Blank



Photo Mask



Process



Display Panel



Key Figures

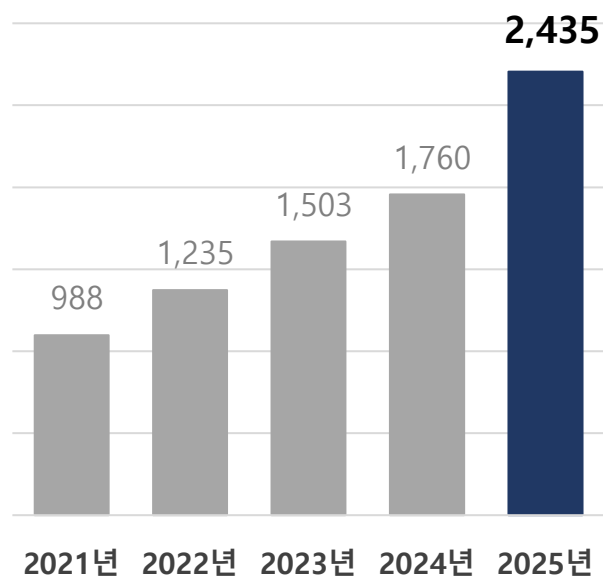
Units : KRW

재무 현황	+25% YoY	+41% YoY	243B	50B
	매출액 5Y CAGR 2021~2025 (연결기준)	영업이익률 5Y CAGR 2021~2025 (연결기준)	매출액 Y2025 연결기준	영업이익 Y2025 연결기준
보유 현황	236	335	Investment, Bio Lab	
	특허 보유 수 국내외 포함	임직원 수 2026년 1월 기준	자회사 보유 S&S Investment S&S Lab	
고객 현황	About 70%	About 30+		
	해외 매출 비중	고객사 수 국내외 포함		

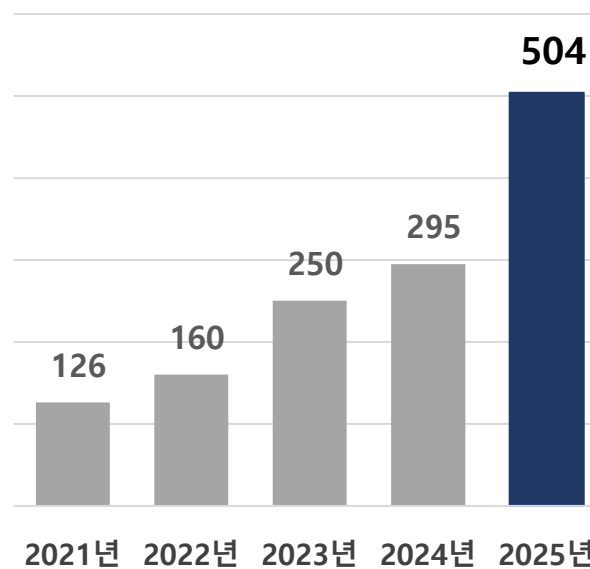
2025년도 재무 현황 (연결 기준)

- 2025년 기준으로 매출 2,435억, 영업이익 504억으로 지난 5년간 연간 성장률 약 25% 이상 유지하였습니다.
- 차세대 반도체 시장과 늘어가는 디스플레이 시장의 점유율로 인하여 매출액은 연간 늘어가는 추세입니다.

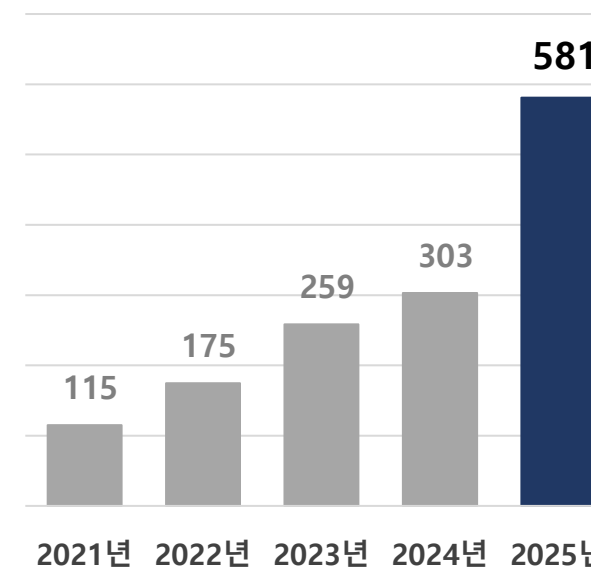
[단위: 억 원]



매출액



영업이익



당기순이익

Key Investment Points

01. 지속적인 매출 성장성

- ✓ 지난 5년간 25% 이상의 꾸준한 매출 성장률과 41% 이상의 영업이익률 성장률 달성

03. 반도체, 디스플레이 시장의 성장

- ✓반도체, 디스플레이 시장 성장에 따른 M/S 확보 및 고객사 선점

02. 미래지향적 사업 구조

- ✓차세대 반도체 개발 양산을 위한 시설 및 장비 투자
- ✓용인 반도체 클러스터 내 EUV Center 설립 및 최종 양산을 위한 검사 장비 투자

04. 고객사 브랜드 이미지 및 네트워킹 노하우

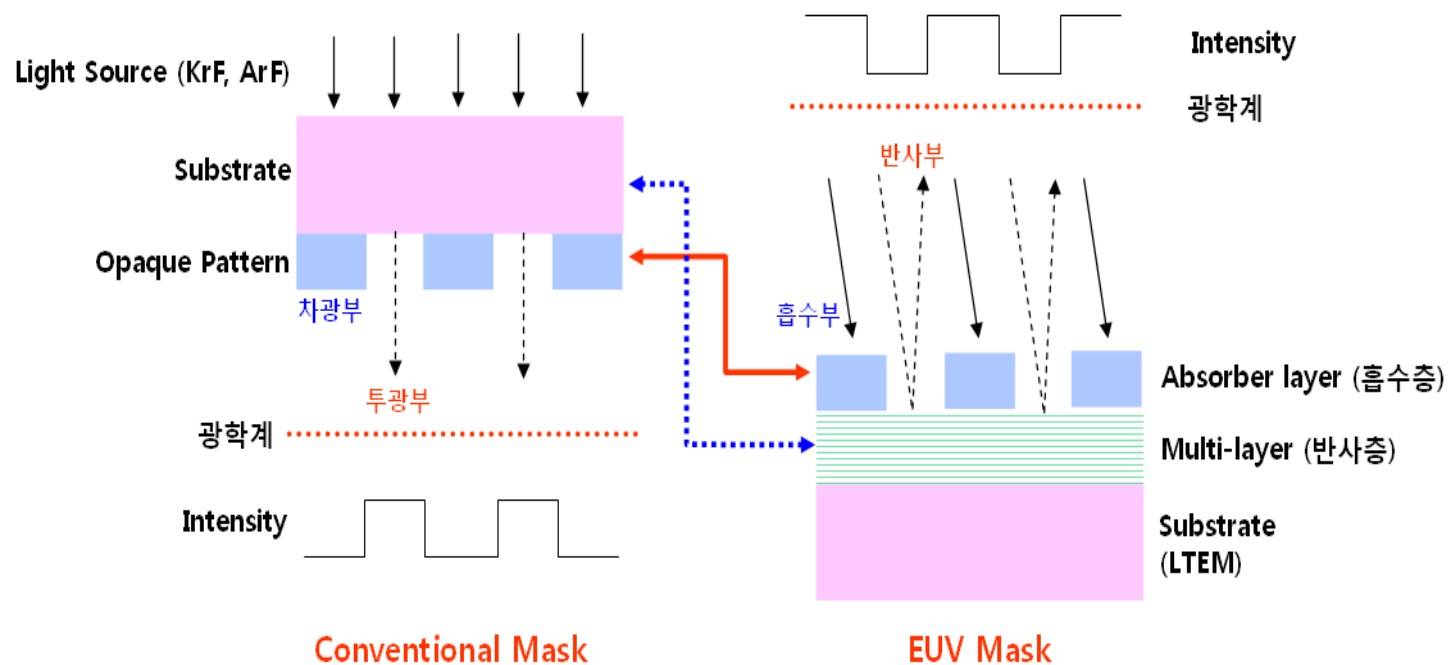
- ✓기존 해외 고객사들과 쌓아온 Connection과 네트워킹 노하우를 베이스로 더 넓고 다양한 고객사 target

EUV Blankmask

- EUV (13.5nm) 노광 기술에 사용되는 포토마스크의 핵심 원재료로, 기계적, 화학적, 광학적 기능을 가진 레이어로 구성

$$\text{Resolution} = k1 \frac{\lambda}{NA}$$

- **k1** : (Process index) : Resist, Blank Mask, OPC etc.. Process Effect
- **λ** : Exposure Wavelength
- **NA** (Numerical Aperture) : Len's Size

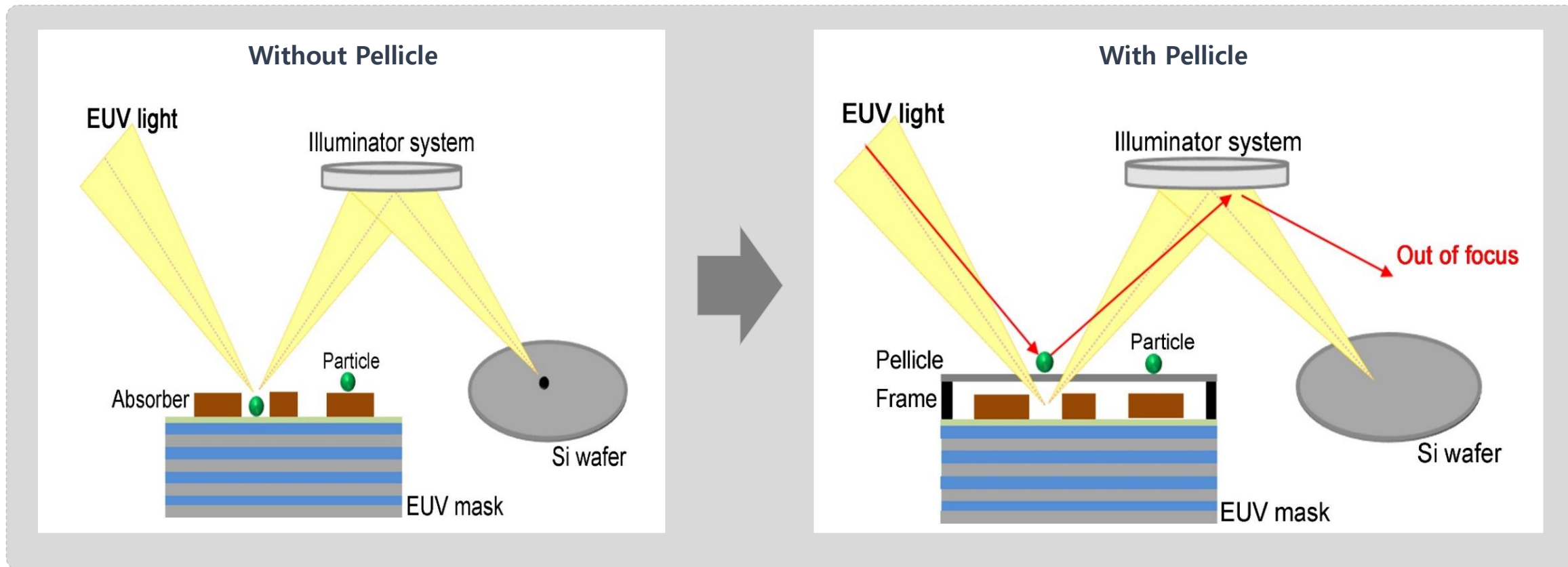


EUV용 Blankmask의 효과

- Resolution (해상력)은 파장에 비례하기 때문에 ArF 대비 1/14 파장의 EUV 노광을 도입함으로써 미세 회로 패턴 해상력을 강화함
- EUV Blankmask는 EUV lithography 기술의 핵심 고부가가치 소재 부품

EUV Pellicle

- 마스크 위에 얇은 박막을 씌워, 오염물로부터 마스크 보호하여 불량 패턴을 방지하는 반도체 소재



EUV Pellicle 필요성

- Pellicle이 없을 경우, 주기적인 세정 및 검사가 필요.
- Pellicle 적용은 마스크 검사 빈도를 낮추면서 공정 효율을 증가시킬 수 있음.

감사합니다.

EOD